

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年7月2日(02.07.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/137527 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/314 (2006.01)

都港区芝大門一丁目13番9号 昭和電
工株式会社内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2019/048351

(74) 代理人: 田中 秀 ▲ て つ ▼, 外 (TANAKA
Hidetetsu et al.); 〒1056032 東京都港区虎ノ門四
丁目3番1号 城山トラストタワー32階 特許
業務法人日栄国際特許事務所 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2019年12月10日(10.12.2019)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2018-240515 2018年12月25日(25.12.2018) JP

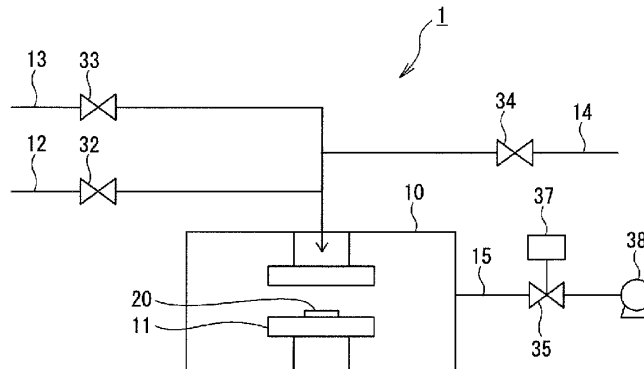
(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人: 昭和電工株式会社 (SHOWA DENKO
K.K.) [JP/JP]; 〒1058518 東京都港区芝大門
一丁目13番9号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 谷本 陽祐 (TANIMOTO Yosuke);
〒1058518 東京都港区芝大門一丁目13
番9号 昭和電工株式会社内 Tokyo (JP).
長田 師門 (OSADA Shimon); 〒1058518 東京

(54) Title: METHOD FOR REMOVING DEPOSITS AND METHOD FOR FORMING FILM

(54) 発明の名称: 付着物除去方法及び成膜方法



(57) Abstract: Provided are: a method for removing deposits, the method being capable of removing sulfur-containing deposits which adhere to the inner surface of a chamber or the inner surface of a pipe connected to the chamber without dismantling the chamber; and a method for forming a film. Sulfur-containing deposits, which adhere to at least one among the inner surface of the chamber (10) and the inner surface of an exhaust pipe (15) connected to the chamber (10), are removed by reacting with a cleaning gas that includes an oxygen-containing compound gas.

(57) 要約: チャンバーの内面又はチャンバーに接続された配管の内面に付着している、硫黄を含有する付着物を、チャンバーを解体することなく除去することが可能な付着物除去方法及び成膜方法を提供する。チャンバー(10)の内面及びチャンバー(10)に接続された排気用配管(15)の内面の少なくとも一方に付着している、硫黄を含有する付着物を、酸素含有化合物ガスを含むクリーニングガスと反応させることにより除去する。

[続葉有]



WO 2020/137527 A1

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))